

Взаимобратимое плазмонное переключение в графеновом нанорезонаторе, нагруженном оболочечной квантовой точкой

М.Ю.Губин, А.В.Шестериков, А.В.Прохоров, В.С.Волков

Рассмотрена модель полностью плазмонного переключателя на основе графенового волновода, интегрированного с нагруженным квантовой точкой штыревым нанорезонатором. С использованием численного моделирования полного поля показано, что последовательные включения/выключения управляющей поверхностной плазмон-поляритонной волны на входе волновода приводят к изменению фазы сигнальной плазмон-поляритонной волны в нанорезонаторе на π . Это вызывает двусторонние переключения режима работы устройства – от почти полной блокировки до устойчивого пропускания сигнальной плазмон-поляритонной волны через волновод. Данный эффект реализуется при скоростях ~ 0.5 ТГц для электромагнитных волн ИК диапазона, локализованных в устройстве с размером области переключения 40×20 нм.

Ключевые слова: графеновый волновод, нанорезонатор, квантовая точка, полностью плазмонное переключение.

1. Введение

Достижения современных графеновых технологий [1–3] и квантовой наноплазмоники [4, 5] позволяют надеяться на практическое воплощение принципиально новых устройств обработки информации на базе транзисторов, функционирующих на терагерцевых частотах и имеющих размер в несколько нанометров. Такие устройства могут быть основаны на усовершенствованных методах управления поверхностными плазмон-поляритонами (ППП) [6–8] в двумерных средах и гибридных системах с высокоподвижными электронами и сверхбыстрыми нелинейностями [9–12]. Для их производства могут использоваться графеновые материалы, нагруженные полупроводниковыми наноструктурами, в том числе полупроводниковыми квантовыми точками (КТ) [13, 14]. Наиболее простыми являются системы, в которых КТ находятся на таком удалении от двумерного материала, при котором структура электронных уровней системы не подвержена гибридизации.

Эффективное взаимодействие КТ и поверхностной волны (КТ–ППП-взаимодействие) в данных системах достигается при выполнении условия сильной связи [15, 16]. Это означает, что константа КТ–ППП-связи превышает характерные время рассеяния электронов в графене [17] и время изменения скорости спонтанной релаксации в системе [16, 17], в результате чего появляется возможность эффективно управлять амплитудно-фазовыми характеристиками ППП путем изменения поляризации КТ. Вместе с тем, даже при выполнении условия сильной свя-

зи и достижении «узких» резонансов для ППП [18], открытым остается вопрос об обратимости и влиянии эффекта памяти (rewritable memory effect) на функциональность подобных устройств [19].

В настоящей работе представлены результаты исследования взаимодействия полупроводниковой оболочечной КТ и ППП-мод, локализованных на поверхности двухслойного графена. Определены два устойчивых состояния поляризации КТ при ее взаимодействии с двумя ППП (сигнал/накачка) при использовании лестничной схемы межуровневых переходов в КТ, которая помещена в графеновый штыревой нанорезонатор. Показано, что включение (выключение) ППП накачки приводит к изменению населенностей уровней, а также нелинейных поляризаций КТ и, как следствие, к возможности управления нелинейным фазовым набегом для сигнального ППП. В частности, при изменении фазы сигнального ППП на π , индуцированном ППП накачки, возможна реализация взаимобратимых переходов от конструктивной интерференции в штыревом нанорезонаторе к деструктивной. Характерная частота таких переключений составляет ~ 0.5 ТГц для нанорезонатора размером 40×20 нм. Обсуждаемые эффекты могут быть использованы для реализации сверхбыстрых плазмонных транзисторов и при проектировании сенсоров и датчиков с «мгновенным» откликом на их основе.

2. Математическая модель распространения ППП через графеновый волновод, интегрированный со штыревым нанорезонатором

Рассмотрим модель графенового волновода и связанного с ним штыревого нанорезонатора, содержащего оболочечную КТ (рис.1). В отсутствие резонатора постоянная распространения β для локализованных на двух графеновых листах ППП подчиняется дисперсионному уравнению [3]

М.Ю.Губин, А.В.Шестериков, А.В.Прохоров. Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г.Столетовых, Россия, 600000 Владимир, ул. Горького, 87; e-mail: av_pr_vl_33@mail.ru
В.С.Волков. Центр фотоники и двумерных материалов Московского физико-технического института, Россия, Московская обл., 141701 Долгопрудный, Институтский пер., 9

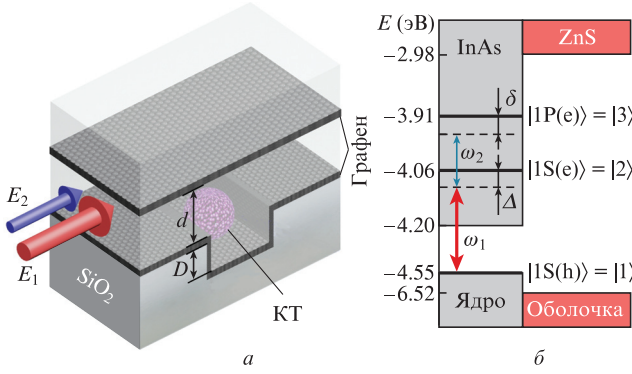


Рис.1. Модель штыревого нанорезонатора на основе двух структурированных графеновых листов и оболочечной КТ, помещенных в диэлектрик (а), и схема взаимодействия лестничного типа ППП и оболочечной InAs/ZnS-KT с радиусом $a_{\text{QD}} = 9.9$ нм; рабочие энергетические уровни в КТ расположены в валентной зоне ($E_{|1\rangle} = -4.55$ эВ) и в зоне проводимости ($E_{|2\rangle} = -4.063$ эВ и $E_{|3\rangle} = -3.908$ эВ) (б). Цветной вариант рис.1 помещен на сайте нашего журнала <http://www.quantum-electron.ru>.

$$-k_h [\pm \exp(-k_h d) - 1] = 2ik_0 c \varepsilon_d \varepsilon_0 / \sigma_g, \quad (1)$$

где $k_h = \sqrt{\beta^2 - k_0^2}$; c – скорость света; $k_0 = 2\pi/\lambda_0$; ε_0 – диэлектрическая постоянная; ε_d – диэлектрическая проницаемость материала диэлектрика между листами графена с расстоянием d между ними. Общая проводимость графена $\sigma_g = \sigma_{\text{inter}} + \sigma_{\text{intra}}$ задается формулой Кубо и состоит из внутризонной проводимости

$$\sigma_{\text{intra}} = i \frac{8\sigma_0 k T \hbar}{\omega + i/\tau} \left\{ \frac{\mu_c}{kT} + 2 \ln \left[\exp\left(-\frac{\mu_c}{kT}\right) + 1 \right] \right\}$$

и межзонной проводимости

$$\sigma_{\text{inter}} = i \frac{\sigma_0}{\pi} \ln \left[\frac{2|\mu_c| - (\omega + i/\tau)\hbar}{2|\mu_c| + (\omega + i/\tau)\hbar} \right],$$

где k – постоянная Больцмана; T – температура; μ_c – химический потенциал; $1/\tau$ – скорость рассеяния; $\sigma_0 = \pi e^2 / (2\hbar)$; e – заряд электрона.

Для моделирования работы устройства мы выбираем эффективную толщину графена $\Delta_g = 2$ нм (что соответствует шагу дискретизации в методе конечных разностей во временной области (FDTD) [20] и существенно отличается от истинной толщины графенового листа, равной ~ 0.33 нм); другие параметры таковы: $\mu_c = 0.6$ эВ, $\tau = 0.9$ пс, $\varepsilon_d = 2.022$, длина волны сигнального поля $\lambda_2 = 8.04$ мкм, длина волны накачки $\lambda_1 = 2.56$ мкм. При выбранных параметрах внутризонная проводимость превышает межзонную для поля накачки и доминирует над ней для сигнального поля (рис.2). Вместе с тем для учета вклада межзонной проводимости при проведении основанного на методе FDTD моделирования требуется ее аппроксимация формулой Паде:

$$\bar{\sigma}_{\text{inter}} = \frac{a_0 + a_1(i\omega) + a_2(i\omega)^2}{1 + b_1(i\omega) + b_2(i\omega)^2}, \quad (2)$$

коэффициенты в которой определяются путем подгонки через реперные частоты ω_{p1}, ω_{p2} и ω_{p3} [21]. В результате такой аппроксимации вблизи λ_2 были получены коэффициенты $a_0 = 2.346 \times 10^{-8}$, $a_1 = -2.112 \times 10^{-20}$, $a_2 = 9.589 \times$

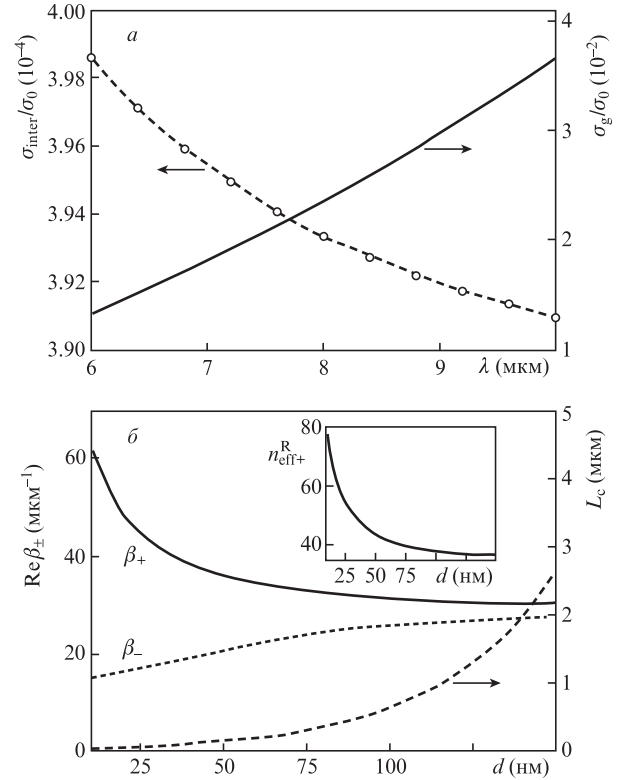


Рис.2. Частотные зависимости общей (σ_g) и межзонной (σ_{inter}) проводимостей с нанесенными на них результатами аппроксимации формулой Паде (кружки) (а), а также зависимости постоянных распространения β_{\pm} и длины взаимодействия $L_c = 2\pi/(2\sqrt{2}|\beta_- - \beta_+|)$ для сигнального ППП от расстояния между листами графена d (б). На вставке – зависимость эффективного показателя преломления от расстояния d .

10^{-39} , $b_1 = -6.745 \times 10^{-19}$, $b_2 = 1.007 \times 10^{-31}$ по трем реперным длинам волн $-\lambda_{p1} = 7.2$ мкм, $\lambda_{p2} = 8.2$ мкм и $\lambda_{p3} = 9.2$ мкм (рис.2,а).

Для оценки типа связи ППП с двухслойным графеном используется параметр

$$\xi = \text{Re} \left(\frac{\sigma_g}{i c \varepsilon_0 \varepsilon_d k_0} \right).$$

Случай $d > \xi$ соответствует слабой связи ППП с графеном, при которой дисперсионные кривые для двухслойного графена имеют гиперболическую форму и практически совпадают с дисперсионными кривыми для однослойного графена. Напротив, случай $d < \xi$ отвечает сильной ППП–графен-связи, для которой дисперсионные кривые существенно отличаются от своих аналогов для монослоя графена [22]. Чтобы обеспечить сильную связь ППП с графеном для сигнального поля с λ_2 , выберем $d = 20$ нм и с учетом того, что для используемого графена $\xi = 71$ нм, получим очень хорошую локализацию плазмон-поляритонной моды на характерной длине волны $\lambda_{\text{SPP}+} = 135.5$ нм. Отметим, что уравнение (1) имеет два решения, β_+ и β_- (рис.2,б), соответствующие симметричной и антисимметричной модам [22], но мы будем рассматривать исключительно β_+ , поскольку в данном случае электромагнитное поле очень хорошо локализуется в зазоре между графеновыми листами. Это потребует в дальнейшем для обеспечения сильной связи, но уже между ППП и КТ, помещенной в зазор между листами. Тогда, определив

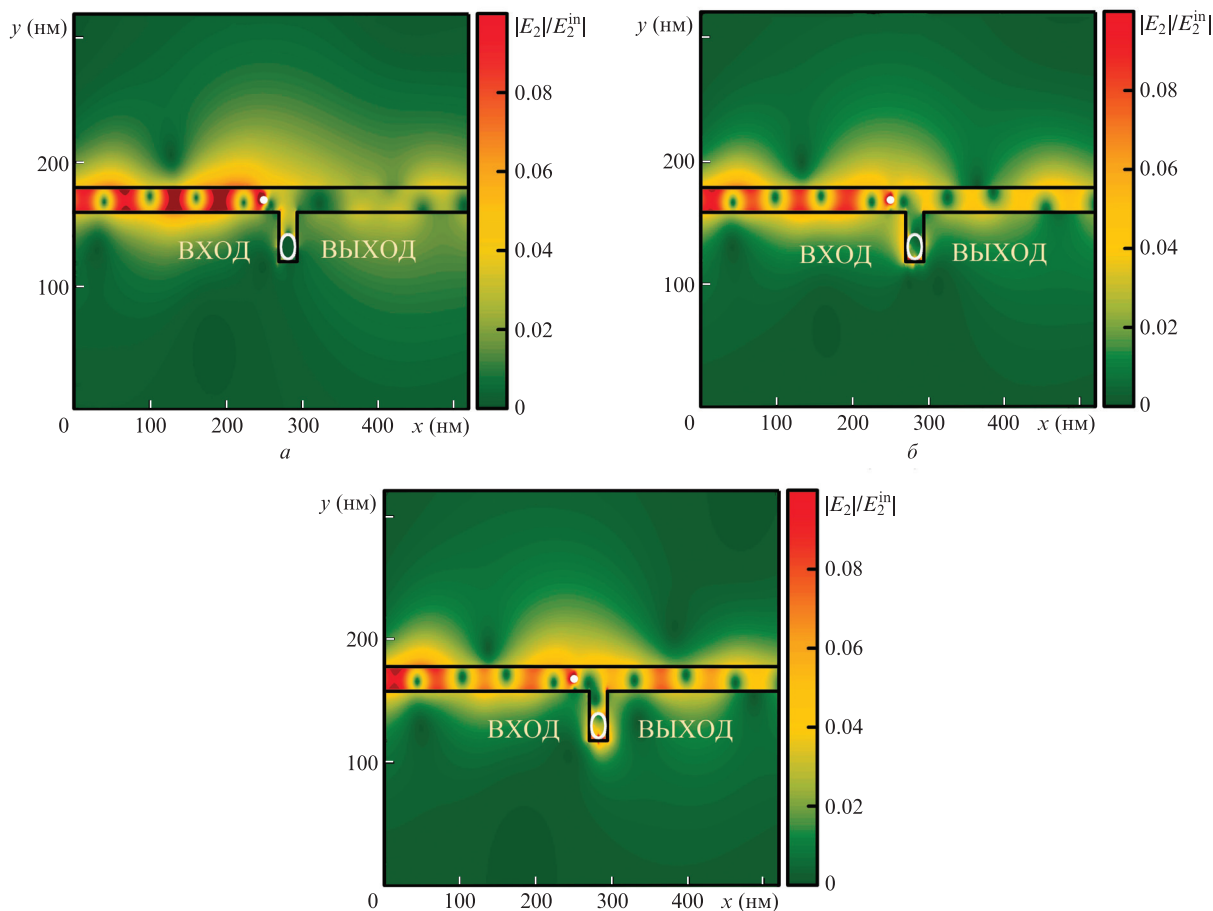


Рис.3. Контурные пространственные зависимости распределения результирующей электрической компоненты поля $(E_{2x}^2 + E_{2y}^2)^{1/2}$ для сигнального ППП в моменты времени $t = 5$ пс (при включенной накачке) (а), 12 пс (в момент изменения режима пропускания) (б) и 15 пс (при выключенной накачке) (в). Белая точка между листами графена – место расположения источника поля (магнитный диполь), белый кружок внутри резонатора – место расположения КТ. Цветной вариант рис.3 помещен на сайте нашего журнала <http://www.quantum-electron.ru>.

эффективный показатель преломления графенового волновода в виде $n_{\text{eff}\pm} = n_{\text{eff}\pm}^R + in_{\text{eff}\pm}^I = \beta_{\pm}/k_0$, можно оценить для ППП как длину волны $\lambda_{\text{SPP}\pm} = 2\pi/\text{Re}\beta_{\pm}$, так и ее характерную длину распространения $\bar{L}_{\text{SPP}\pm} = \lambda_0/(4\pi\text{Im}n_{\text{eff}\pm})$ по состоящему из двух параллельных листов графена волноводу. В частности, параметр $\bar{L}_{\text{SPP}\pm}$ составит 3.7 мкм для сигнального ППП.

Рассматриваемые далее штыревые резонаторы обычно используются для фильтрации электромагнитного сигнала на фиксированных длинах волн [23]. В настоящей работе предлагается внедрить в такой резонатор активный центр (КТ или квантовую яму, молекулу красителя и другие хромофоры), с помощью которого можно эффективно управлять величиной фазового сдвига сигнального поля, взаимодействующего с данным центром. Достичь этого можно изменением поляризации соответствующих межуровневых переходов центра при воздействии на него дополнительного поля накачки, что может быть описано с использованием формализма матрицы плотности и на основе анализа устойчивости нелинейных систем [24].

Для начала мы выберем длину выступа D штыревого резонатора таким образом, чтобы сигнальное поле было настроено на максимум интерференции и не задерживалось резонатором. Это возможно, если «плазмонный» путь сигнального ППП в резонаторе $\Delta S = (2D + d)n_{\text{eff}\pm}^R$ будет равен целому числу длин волн, т.е. $l\lambda_0$, где $l = 0, 1, 2, \dots$. Тогда, выбрав $l = 1$, мы получим $D = 40$ нм (ши-

рина резонатора составляет 24 нм), и сигнальное поле будет беспрепятственно распространяться через область волновода, содержащего нанорезонатор (рис.3,в).

3. Взаимообратимые переключения коэффициента пропускания сигнальной ППП-моды через графеновый волновод, интегрированный с нагруженным КТ нанорезонатором

Мы полагаем, что в нанорезонаторе, нагруженном оболочечной InAs/ZnS-КТ, реализуется С-схема плазмон-экситонного взаимодействия лестничного типа с двумя ППП-модами (см. рис.1,б). Управляющее поле накачки E_1 (определяемое совокупностью компонент, т.е. $E_1^2 = E_{1x}^2 + E_{1y}^2$) настроено на межзонный переход $1S(h) \rightarrow 1S(e)$, а сигнальное поле E_2 – на внутризонный переход $1S(e) \rightarrow 1P(e)$. Резонансные частоты соответствующих переходов могут быть получены в виде (см. рис.1)

$$\omega_{12} = \frac{eE_g}{\hbar} + \frac{2\hbar k_{1;0}}{D_{\text{QD}}^2} \left(\frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_h} \right), \tag{3a}$$

$$\omega_{23} = \frac{2\hbar}{D_{\text{QD}}^2 m_e} (k_{1;1}^2 + k_{1;0}^2), \tag{3б}$$

где $E_g = 0.35$ эВ – ширина запрещенной зоны; $m_e = 0.026m_0$ и $m_h = 0.41m_0$ – эффективные массы электрона и дырки в InAs соответственно; m_0 – масса свободного электрона; $k_{1;1} = 4.439$ и $k_{1;0} = \pi$ – корни функции Бесселя. Согласно выражению (3б), для реализации резонансных взаимодействий с сигнальной ППП-модой на длине волны $\lambda_2 = 8.04$ мкм радиус КТ $a_{\text{QD}} = D_{\text{QD}}/2$ должен составить 9.9 нм. Тогда длина волны накачки $\lambda_1 = 2.56$ мкм будет точно настроена на межзонный резонанс в соответствии с выражением (3а) и условием $\omega_{12} = \omega_1$.

Проведенное численное моделирование демонстрирует быстрое затухание ППП накачки в условиях слабой связи ($\xi = 6$ нм) для электромагнитного поля на длине волны λ_1 в графеновом волноводе. Однако даже в этом случае интенсивность ППП накачки оказывается достаточной для создания индуцированной поляризации на переходе $1S(h) \rightarrow 1S(e)$ в КТ.

Дипольный момент внутризонного перехода в КТ приближенно можно оценить как $\mu_{32} = 0.433ea_{\text{QD}}\Lambda$, где $\Lambda = 3\epsilon_{\text{ZnS}}/(2\epsilon_{\text{ZnS}} + \epsilon_{\text{InAs}})$, $\epsilon_{\text{InAs}} = 12.3$ – диэлектрическая проницаемость сердцевинки КТ, $\epsilon_{\text{ZnS}} = 8.3$ – диэлектрическая проницаемость оболочки. В то же время дипольный момент межзонного перехода может быть найден из выражения

$$\mu_{21}^2 = \frac{e^2}{6m_0\omega_1^2} \left(\frac{m_0}{m_e} - 1 \right) \frac{E_g e (E_g + \Delta_s)}{E_g + 2\Delta_s/3},$$

где $\Delta_s = 0.43$ эВ – энергия спин-орбитального расщепления для InAs. Расчетные значения параметров для рассматриваемой InAs/ZnS-КТ таковы: $\mu_{32} = 5.9 \times 10^{-28}$ Кл·м и $\mu_{21} = 14.9 \times 10^{-29}$ Кл·м.

В отсутствие поля E_1 уровень $1S(e)$ не заполнен, поэтому стационарными решениями для матричных элементов переходов в КТ являются их нулевые значения, т. е. $\bar{\rho}_{21} = \bar{\rho}_{32} = 0$. В такой ситуации сигнальное поле свободно распространяется через область, содержащую нанорезонатор (рис.3,б). Мгновенное включение поля E_1 приводит к росту осциллирующей поляризации на переходе $1S(e) \rightarrow 1P(e)$. В процессе последующей эволюции система стабилизируется при новых стационарных решениях для поляризации (см. Приложение):

$$\begin{aligned} \bar{\rho}_{32} &= -\frac{i\Omega_2(\Omega_1^2 n_{21} + D_1 D_2 n_{32} + \Omega_2^2 n_{32})}{\Omega_1^2 D_1 + D_1 D_2 \Gamma_{32} + \Omega_2^2 \Gamma_{32}}, \\ \bar{\rho}_{21} &= -\frac{i\Omega_1(\Omega_1^2 n_{21} + \Omega_2^2 n_{32} + D_2 n_{21} \Gamma_{32})}{\Omega_1^2 D_1 + D_1 D_2 \Gamma_{32} + \Omega_2^2 \Gamma_{32}}, \end{aligned} \quad (4)$$

где $\Omega_1 = g_1 B$ и $\Omega_2 = g_2 a$ – частоты Раби ППП накачки и сигнальной ППП-моды; B и a – амплитуды соответствующих ППП; $D_1 = i\Delta + \gamma_{21}$; $D_2 = i\delta + \gamma_{31} + \gamma_{32}$; $\Gamma_{32} = i(\delta - \Delta) + \gamma_{21} + \gamma_{32} + \gamma_{31}$; $\bar{n}_{21} = \bar{\rho}_{22} - \bar{\rho}_{11}$; $\bar{n}_{32} = \bar{\rho}_{33} - \bar{\rho}_{22}$; $\bar{\rho}_{11}$, $\bar{\rho}_{22}$ и $\bar{\rho}_{33}$ – стационарные решения для населенностей уровней. Следует отметить, что при субволновом расстоянии между КТ и графеном релаксационные параметры существенно изменяются [16, 25–27]. Величину этого изменения можно определить либо точно для упрощенного случая, когда хромофор находится вблизи плоского проводящего слоя [26], либо в рамках приближенного расчета локальной плотности оптических/плазмонных состояний (local density of optical states, LDOS [28]) на основе имеющегося распределения поля в нанорезонаторе. Здесь мы использовали

первый подход и получили оценку релаксационных параметров: $\gamma_{32(31)} = 1.43 \times 10^{12} \text{ с}^{-1}$ и $\gamma_{21} = 5 \times 10^{11} \text{ с}^{-1}$ [18]. На самом деле задача точного расчета скорости спонтанной релаксации неточечного излучателя в резонаторе сложной формы представляет собой фундаментальную задачу, требует уточнения и имеет нетривиальные решения даже для простых геометрий [27].

Для изучения динамики связанной системы ППП–КТ мы применяем комбинированный подход [29] на основе численного решения системы дифференциальных уравнений для матрицы плотности (П2) и численного моделирования электромагнитного поля методом FDTD [20]. В рамках такого подхода мы полагаем, что параметр плазмон-экситонной связи

$$g_{1(2)}(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{\omega_{1(2)}}{\hbar \epsilon_0 V_{\text{eff}1(2)}}} \kappa_{1(2)}(\mathbf{r}) \mu_{21(32)},$$

где коэффициент $\kappa_{1(2)}(\mathbf{r}) = E_{1(2)}(\mathbf{r})/E_{1(2)}^{\text{max}}$ задает распределение поля в точке нахождения КТ с координатой \mathbf{r} , а $V_{\text{eff}1(2)} = \lambda_{\text{SPP}+1(2)}^3$ соответствует эффективному объему моды. Определяя значения данных параметров непосредственно из результатов моделирования поля в резонаторе, получаем $g_1 = 6.575 \times 10^{11} \text{ с}^{-1}$ и $g_2 = 1.472 \times 10^{12} \text{ с}^{-1}$.

Принцип переключения (рис.3) основан на управлении фазовым сдвигом сигнальной ППП-моды в резонаторе путем управления значениями поляризации (4) с помощью поля накачки. Такой фазовый набег может быть рассчитан по формуле $\Delta\phi = (2\pi/\lambda_2) n_{\text{QD}}^R D_{\text{QD}}$, где эффективный показатель преломления КТ имеет вид $n_{\text{QD}} \approx \chi_{\text{QD}}/2$ и выражен через ее восприимчивость $\chi_{\text{QD}} = [N\mu_{32}/(\epsilon_0 E_2)] \times \bar{\rho}_{32}$ (N – концентрация носителей заряда). Отсюда диэлектрическая проницаемость КТ, наведенная внешним полем, может быть представлена как $\epsilon_{\text{QD}} = 1 + \chi_{\text{QD}}$. Для случая $a = 1$ и $B = 10$ получим, что требуемый для перехода от конструктивной интерференции к деструктивной фазовый сдвиг $\Delta\phi = \pi$ можно реализовать при частотных отстройках $\Delta_m = -6.156 \times 10^{12} \text{ с}^{-1}$ и $\delta_m = 1.697 \times 10^{13} \text{ с}^{-1}$ (при этом $\text{Re}\bar{\rho}_{32} = 0.0318$, $\text{Im}\bar{\rho}_{32} = 0.0065$).

Для тестирования работы устройства мы используем стробирование нанорезонатора полем накачки на частоте $2\pi/\tau_d$ при включенном сигнальном поле. Амплитуда поля накачки при этом меняется скачком от нуля до E_1^{max} и обратно в моменты времени $t = m\tau_d$ ($\tau_d = 10$ пс, $m = 0, 1, \dots$), приводя к осцилляциям диэлектрической проницаемости ϵ_{QD}^R квантовой точки (рис.4,б).

Численное моделирование электромагнитного поля осуществлялось с учетом изменяющегося вслед за поляризациями фазового набегу для сигнальной ППП-моды в резонаторе. В качестве численного критерия прохождения сигнального ППП через волновод был выбран коэффициент пропускания, определяемый как отношение интегральных интенсивностей поля E_2 с различных сторон от нанорезонатора, т. е. $K_{\text{tr}} = (S_{\text{tr}}/S_{\text{total}}) \times 100\%$, где S_{total} – интегральная интенсивность поля внутри волновода, включая полость резонатора, а S_{tr} – интегральная интенсивность поля справа от середины резонатора, но в пределах волновода. Так, при $E_1 = 0$ коэффициент пропускания K_{tr} составляет 33.3%, уменьшаясь до 7.6% при $E_1 = E_1^{\text{max}}$ (рис.4). Важной особенностью представленной схемы является достижение «узких» плазмонных резонансов в штыревом нанорезонаторе, обеспечивающих высокий коэффициент пропускания сигнального поля при выключенном поле накачки. Включение поля накачки приводит

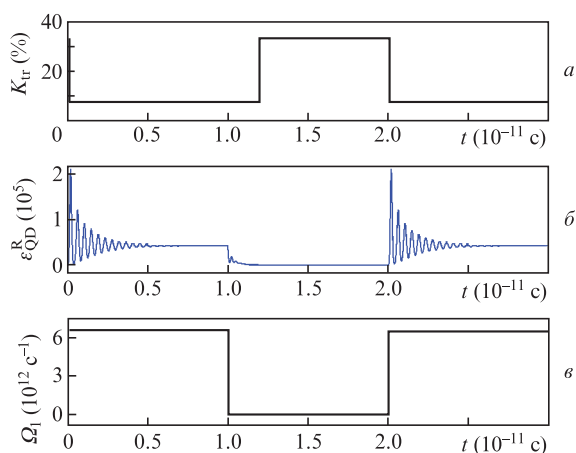


Рис.4. Временные зависимости коэффициента пропускания K_{tr} сигнального поля через графеновый волновод, интегрированный со штыревым резонатором (а), диэлектрической проницаемости КТ (б) и частоты Раби Ω_1 (в).

к продолжительным осцилляциям диэлектрической проницаемости КТ. Вместе с тем коэффициент пропускания снижается до минимального значения почти «мгновенно», что связано с нарушением условий резонанса даже при малых изменениях ϵ_{QD}^R (рис.4). Обратный переход системы при выключении поля накачки осуществляется за время $\tau_{sw} = 2$ пс, обеспечивающее скорость переключения 0.5 ТГц.

4. Возможности технической реализации полностью плазмонных переключателей с КТ

Вопросы проектирования и производства полностью плазмонных переключателей требуют отдельного рассмотрения. Создание подобных устройств возможно с учетом уже имеющихся современных технологий, но при использовании комбинации сразу нескольких различных экспериментальных методов. В частности, основой для производства устройств могут служить диэлектрические подложки, изготовленные из кварцевого стекла SiO_2 или оксида алюминия Al_2O_3 , на поверхности которых выгравированы углубления нужного размера и формы [30]. Осаждение слоя графена на поверхность такого структурированного диэлектрика может быть реализовано с помощью плазмохимического осаждения (plasma-enhanced chemical vapor deposition, PECVD [31]). В этом случае осаждение графена происходит при соединении двух прекурсоров, в качестве которых используются водород и метан при давлении 10 мТор и температуре 500–900 °С. Однако вопрос стабильности толщины слоя графена при покрытии им таких объемных элементов, как штыревой нанорезонатор, требует экспериментального изучения, аналогичного выполненному в [32] для диэлектрических полосок. Вопросы модификации графена [33], в том числе производство допированного графена с измененными химическим потенциалом и скоростью рассеяния электронов, также представляют собой отдельную задачу.

Следующий этап связан с загрузкой КТ в нанорезонатор, что может быть выполнено путем применения техники микро- и наноманипулирования с использованием иглы атомно-силового микроскопа [34]. Упрощенная технология заключается в нанесении слоя КТ на поверхность графена при их последующем механическом удале-

нии с поверхности таким образом, чтобы оставить в нанорезонаторе осевшие единичные КТ.

Покрытие слоя графена диэлектриком является наиболее сложным этапом, поскольку требует применения низкотемпературных методов для сохранения целостности графенового слоя. В частности, с помощью техники атомно-слоевого осаждения (atomic layer deposition, ALD [35]) с такими прекурсорами, как AlCl_3 и H_2O , осаждение Al_2O_3 может осуществляться при температуре 200–400 °С. Использование триметиламина и воды позволяет снизить температуру осаждения графена до 125 °С [36] и до 100 °С [37]. Следует отметить, что качество адгезии материалов существенно зависит от состояния поверхности графена с учетом его изначально гидрофобной природы. Для решения данной проблемы применяют методы функционализации поверхности графена, в частности нанесение тонкого, толщиной 1–2 нм, слоя Al на поверхность графена [38], который полностью окисляется при атомно-слоевом осаждении. Это определяет качественную границу графен–диэлектрик без ухудшения подвижности электронов в графене. Последующие этапы – нанесение второго слоя графена для создания структуры волновода и его зарашивание диэлектриком – требуют поочередного использования методов PECVD и ALD. В отсутствие доступа к ALD технологическая цепочка может быть перестроена на применение метода электронно-лучевого испарения для осаждения диэлектрика на графен [39]. Однако его использование требует жестко заданной геометрии расположения источника и образца (образец находится сверху камеры), которая может быть неприемлема для рассматриваемого устройства нанорезонатор + КТ.

Остановимся на деталях создания и применения эффективного ближнеполевого источника ППП для исследуемой системы. В экспериментальных условиях имеющиеся источники ближнего поля представлены, в основном, устройствами ближнеполевой микроскопии (ближнеполевой сканирующий микроскоп, БСМ), оснащенными зондами различной конфигурации. Обычно это заостренное окончание оптического волновода, имеющее различную геометрию, размеры и топологию. Самый простой случай – округлое окончание, в котором в зависимости от радиуса его кривизны могут возбуждаться различные конфигурационные резонансы, отвечающие разным моментам электромагнитного поля [40]. В соответствии с этим различают дипольные источники (электрические и магнитные [41]), квадрупольные и др. Однако, даже при использовании игл БСМ на основе высокорелрактивных материалов [42], их размер остается несоизмеримым с характерным масштабом (40×20 нм) плазмонного переключателя (см. рис.1,а).

Частичным выходом из ситуации могут служить полностью диэлектрические наноантенны [43], а также гибридные наноструктуры, в том числе квантовые нанопровода и нанопроволоки [44], позволяющие осуществить захват и преобразование энергии электромагнитного поля на наномасштабе. Такие системы применяются для создания нанолазеров [45], но могут быть использованы также в качестве источников ближнего поля с заданными классическими [46] и квантовыми [47, 48] характеристиками и интегрированы в плазмонные схемы (см. рис.1,а).

Еще одним важным вопросом является проблема локализации распространяющихся по поверхности графена ППП в узкой области вдоль оси z . Такая задача может

быть решена чисто технически при использовании микро- и наноструктурированных подложек на основе сочетания слоев Si и SiO₂. На тех участках, где требуется локализовать ППП, подложкой для графена служит Si с тонким буферным слоем SiO₂, а на оставшихся – монокристаллический SiO₂. Таким образом, Si и слой графена над ним выступают в роли протяженного конденсатора, при подаче напряжения на который химический потенциал графена уменьшается по сравнению с таковым для областей над монокристаллическим SiO₂ [49–51]. В итоге возникает волноводный эффект: ППП локализируются и распространяются исключительно вдоль областей графена, находящихся над Si, что можно использовать для создания сложных межузловых соединений в системе [30] и шины данных для плазмонных схем.

5. Заключение

В настоящей работе предложена модель и обсуждаются вопросы создания полностью плазмонного взаимобратимого переключателя на базе графенового штыревого резонатора, нагруженного оболочечной КТ. Следует отметить, что сравнительно небольшие длины распространения ППП в графеновых системах по сравнению с таковыми в структурах металл–диэлектрик–полупроводник [52] существенно ограничивают масштабирование подобных устройств до полноценных интегральных схем [53]. Вместе с тем представленная модель может иметь принципиальное значение для разработки как отдельных высокоскоростных переключателей, так и сверхбыстрых сенсоров на их основе. В последнем случае плазмонный переключатель может применяться для быстрого запуска некоторого рабочего алгоритма в электронной части схемы при подаче оптического сигнала на один из ее входов. Кроме того, успехи на пути к достижению высокотемпературной проводимости графена [54, 55] дают надежду на решение вопроса быстрого затухания ППП в графене. При этом дополнительные технические трудности заключаются в сохранении сверхпроводимости при контакте двумерного материала с подложкой [56]. Решение таких вопросов требует использования новой парадигмы при создании функциональных оптических и оптоэлектронных устройств на базе двумерных материалов с уникальными физическими характеристиками [57–59].

Авторы благодарны А.Б.Евлюхину за полезные обсуждения работы. А.В.Шестериков выражает благодарность фонду содействия инновациям за финансовую поддержку по договору 14287ГУ/2019 (программа УМНИК).

Приложение. Математическая модель лестничной схемы ППП–КТ-взаимодействия

Гамильтониан ППП–КТ-взаимодействия может быть представлен в виде

$$H = H_0 + H_v, \quad (\text{П1а})$$

где

$$H_0 = \hbar[\omega_{12}|2\rangle\langle 2| + (\omega_{12} + \omega_{23})|3\rangle\langle 3|] \quad (\text{П1б})$$

– невозмущенный гамильтониан;

$$H_v = -\hbar(\Omega_1|2\rangle\langle 1| + \Omega_1^*|1\rangle\langle 2| + \Omega_2|3\rangle\langle 2| + \Omega_2^*|2\rangle\langle 3|) \quad (\text{П1в})$$

– гамильтониан взаимодействия между полупроводниковой КТ и двумя ППП-модами в соответствии с лестничной схемой взаимодействий (см. рис.1,б); $|1\rangle \equiv |1S(\hbar)\rangle$ – основной энергетический уровень дырки в валентной зоне; $|2\rangle \equiv |1S(e)\rangle$ и $|3\rangle \equiv |1P(e)\rangle$ – электронные уровни в зоне проводимости; Ω_1 и Ω_2 – частоты Раби ППП накачки и сигнальной ППП-моды; ω_{12} и ω_{23} – частоты меж- и внутризонных переходов соответственно.

Эволюция представленной системы описывается с помощью уравнения Лиувилля:

$$\frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}[H, \tilde{\rho}] - \hat{\Gamma}, \quad (\text{П2а})$$

где

$$\begin{aligned} \tilde{\rho} = & \tilde{\rho}_{11}|1\rangle\langle 1| + \tilde{\rho}_{22}|2\rangle\langle 2| + \tilde{\rho}_{33}|3\rangle\langle 3| + \tilde{\rho}_{12}|1\rangle\langle 2| + \tilde{\rho}_{21}|2\rangle\langle 1| \\ & + \tilde{\rho}_{23}|2\rangle\langle 3| + \tilde{\rho}_{32}|3\rangle\langle 2| + \tilde{\rho}_{13}|1\rangle\langle 3| + \tilde{\rho}_{31}|3\rangle\langle 1| \end{aligned} \quad (\text{П2б})$$

– матрица плотности уровней в КТ;

$$\begin{aligned} \hat{\Gamma} = & \gamma_{21}(|2\rangle\langle 2|\tilde{\rho} - 2|1\rangle\langle 2|\tilde{\rho}|2\rangle\langle 1| + \tilde{\rho}|2\rangle\langle 2|) \\ & + \gamma_{32}(|3\rangle\langle 3|\tilde{\rho} - 2|2\rangle\langle 3|\tilde{\rho}|3\rangle\langle 2| + \tilde{\rho}|3\rangle\langle 3|) \\ & + \gamma_{31}(|3\rangle\langle 3|\tilde{\rho} - 2|1\rangle\langle 3|\tilde{\rho}|3\rangle\langle 1| + \tilde{\rho}|3\rangle\langle 3|) \end{aligned} \quad (\text{П2в})$$

– супероператор Линдблада, описывающий процесс спонтанной релаксации в системе; γ_{ij} – скорости спонтанной релаксации соответствующих переходов; $i, j = 1, 2, 3$ и $i \neq j$.

Используя выражения (П1) и (П2), получаем следующую систему уравнений для элементов матрицы плотности:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\rho}}_{11} = & i\tilde{\Omega}_1^*\tilde{\rho}_{21} - i\tilde{\Omega}_1\tilde{\rho}_{12} + 2\gamma_{21}\tilde{\rho}_{22} + 2\gamma_{31}\tilde{\rho}_{33}, \\ \dot{\tilde{\rho}}_{22} = & i\tilde{\Omega}_1\tilde{\rho}_{12} - i\tilde{\Omega}_1^*\tilde{\rho}_{21} + i\tilde{\Omega}_2^*\tilde{\rho}_{32} - i\tilde{\Omega}_2\tilde{\rho}_{23} \\ & - 2\gamma_{21}\tilde{\rho}_{22} + 2\gamma_{32}\tilde{\rho}_{33}, \\ \dot{\tilde{\rho}}_{33} = & i\tilde{\Omega}_2\tilde{\rho}_{23} - i\tilde{\Omega}_2^*\tilde{\rho}_{32} - 2\gamma_{32}\tilde{\rho}_{33} - 2\gamma_{31}\tilde{\rho}_{33}, \\ \dot{\tilde{\rho}}_{12} = & i\tilde{\Omega}_1^*\tilde{\rho}_{22} + i\omega_{12}\tilde{\rho}_{12} - i\tilde{\Omega}_1^*\tilde{\rho}_{11} - i\tilde{\Omega}_2^*\tilde{\rho}_{13} - \gamma_{21}\tilde{\rho}_{12}, \\ \dot{\tilde{\rho}}_{21} = & -i\tilde{\Omega}_1\tilde{\rho}_{22} - i\omega_{12}\tilde{\rho}_{21} + i\tilde{\Omega}_1\tilde{\rho}_{11} + i\tilde{\Omega}_2\tilde{\rho}_{31} - \gamma_{21}\tilde{\rho}_{21}, \quad (\text{П3}) \\ \dot{\tilde{\rho}}_{13} = & i\tilde{\Omega}_1^*\tilde{\rho}_{23} + i(\omega_{12} + \omega_{23})\tilde{\rho}_{13} - i\tilde{\Omega}_1^*\tilde{\rho}_{12} - \gamma_{31}\tilde{\rho}_{13} - \gamma_{32}\tilde{\rho}_{13}, \\ \dot{\tilde{\rho}}_{31} = & -i\tilde{\Omega}_1\tilde{\rho}_{32} - i(\omega_{12} + \omega_{23})\tilde{\rho}_{31} + i\tilde{\Omega}_2\tilde{\rho}_{21} - \gamma_{31}\tilde{\rho}_{31} - \gamma_{32}\tilde{\rho}_{31}, \\ \dot{\tilde{\rho}}_{23} = & i\omega_{23}\tilde{\rho}_{23} + i\tilde{\Omega}_1\tilde{\rho}_{13} + i\tilde{\Omega}_2^*\tilde{\rho}_{33} - i\tilde{\Omega}_2^*\tilde{\rho}_{22} \\ & - \tilde{\rho}_{23}(\gamma_{21} + \gamma_{32} + \gamma_{31}), \\ \dot{\tilde{\rho}}_{32} = & -i\omega_{23}\tilde{\rho}_{32} - i\tilde{\Omega}_1^*\tilde{\rho}_{31} - i\tilde{\Omega}_2\tilde{\rho}_{33} + i\tilde{\Omega}_2\tilde{\rho}_{22} \\ & - \tilde{\rho}_{32}(\gamma_{21} + \gamma_{32} + \gamma_{31}). \end{aligned}$$

Далее мы применяем приближение медленно меняющихся амплитуд для перехода к новым переменным

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_{12} = & \rho_{12} \exp(i\omega_1 t), \quad \tilde{\rho}_{23} = \rho_{23} \exp(i\omega_2 t), \\ \tilde{\rho}_{13} = & \rho_{13} \exp[i(\omega_1 + \omega_2) t], \quad \tilde{\rho}_{11} \equiv \rho_{11}, \quad \tilde{\rho}_{22} \equiv \rho_{22}, \quad \tilde{\rho}_{33} \equiv \rho_{33}, \end{aligned}$$

$$\tilde{Q}_1 = \Omega_1 \exp(i\omega_1 t), \quad \tilde{Q}_2 = \Omega_2 \exp(i\omega_2 t),$$

где $\omega_{1(2)}$ – частоты ППП накачки (сигнальной ППП-моды). Тогда система уравнений (П3) преобразуется к новому виду:

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_{11} &= i\Omega_1^* \rho_{21} - i\Omega_1 \rho_{12} + 2\gamma_{21} \rho_{22} + 2\gamma_{31} \rho_{33}, \\ \dot{\rho}_{22} &= i\Omega_1 \rho_{12} - i\Omega_1^* \rho_{21} + i\Omega_2^* \rho_{32} - i\Omega_2 \rho_{23} - 2\gamma_{21} \rho_{22} + 2\gamma_{32} \rho_{33}, \\ \dot{\rho}_{33} &= i\Omega_2 \rho_{23} - i\Omega_2^* \rho_{32} - 2\gamma_{32} \rho_{33} - 2\gamma_{31} \rho_{33}, \\ \dot{\rho}_{12} &= i\Omega_1^* \rho_{22} + i\Delta \rho_{12} - i\Omega_1^* \rho_{11} - i\Omega_2 \rho_{13} - \gamma_{21} \rho_{12}, \\ \dot{\rho}_{21} &= -i\Omega_1 \rho_{22} - i\Delta \rho_{21} + i\Omega_1 \rho_{11} + i\Omega_2^* \rho_{31} - \gamma_{21} \rho_{21}, \\ \dot{\rho}_{13} &= i\Omega_1^* \rho_{23} + i\delta \rho_{13} - i\Omega_2^* \rho_{12} - \gamma_{31} \rho_{13} - \gamma_{32} \rho_{13}, \\ \dot{\rho}_{31} &= -i\Omega_1 \rho_{32} - i\delta \rho_{31} + i\Omega_2 \rho_{21} - \gamma_{31} \rho_{31} - \gamma_{32} \rho_{31}, \\ \dot{\rho}_{23} &= i(\delta - \Delta) \rho_{23} + i\Omega_1 \rho_{13} + i\Omega_2^* \rho_{33} - i\Omega_2^* \rho_{22} - \rho_{23}(\gamma_{21} + \gamma_{32} + \gamma_{31}), \\ \dot{\rho}_{32} &= -i(\delta - \Delta) \rho_{32} - i\Omega_1^* \rho_{31} - i\Omega_2 \rho_{33} + i\Omega_2 \rho_{22} - \rho_{32}(\gamma_{21} + \gamma_{32} + \gamma_{31}), \end{aligned} \quad (П4)$$

где $\Delta = \omega_{12} - \omega_1$; $\delta = \omega_{12} + \omega_{23} - \omega_1 - \omega_2$. Вводя новые переменные $n_{21} = \rho_{22} - \rho_{11}$ и $n_{32} = \rho_{33} - \rho_{22}$, можно представить систему (П4) в следующем виде:

$$\begin{aligned} \dot{n}_{21} &= 2i\Omega_1 \rho_{12} - 2i\Omega_1^* \rho_{21} + i\Omega_2^* \rho_{32} - i\Omega_2 \rho_{23} - 4\gamma_{21} \rho_{22} + 2(\gamma_{32} - \gamma_{31}) \rho_{33}, \\ \dot{n}_{32} &= 2i\Omega_2 \rho_{23} - 2i\Omega_2^* \rho_{32} - i\Omega_1 \rho_{12} + i\Omega_1^* \rho_{21} - 4\gamma_{32} \rho_{33} - 2\gamma_{31} \rho_{33} + 2\gamma_{21} \rho_{22}, \\ \dot{\rho}_{21} &= -i\Omega_1 n_{21} - i\Delta \rho_{21} + i\Omega_2^* \rho_{31} - \gamma_{21} \rho_{21}, \\ \dot{\rho}_{32} &= -i\Omega_2 n_{32} - i(\delta - \Delta) \rho_{32} - i\Omega_1^* \rho_{31} - (\gamma_{21} + \gamma_{32} + \gamma_{31}) \rho_{32}, \\ \dot{\rho}_{31} &= -i\Omega_1 \rho_{32} - i\delta \rho_{31} + i\Omega_2 \rho_{21} - (\gamma_{31} + \gamma_{32}) \rho_{31}. \end{aligned} \quad (П5а), (П5б), (П5в), (П5г), (П5д)$$

Рассматривая стационарный режим ППП–КТ-взаимодействия (т.е. при $\dot{n}_{21} = \dot{n}_{32} = \dot{\rho}_{21} = \dot{\rho}_{31} = \dot{\rho}_{32} = 0$), находим ρ_{31} из уравнения (П5д) в виде

$$\bar{\rho}_{31} = \frac{i\Omega_2 \bar{\rho}_{21} - i\Omega_1 \bar{\rho}_{32}}{i\delta + \gamma_{31} + \gamma_{32}}, \quad (П6)$$

где $\bar{\rho}_{21}$, $\bar{\rho}_{32}$ и $\bar{\rho}_{31}$ – стационарные значения поляризации соответствующих переходов. Подставив $\bar{\rho}_{31}$ в (П5в) и (П5г), получим выражения

$$0 = -i\Omega_1 n_{21} - \rho_{21} \left(i\Delta + \gamma_{21} + \frac{|\Omega_2|^2}{i\delta + \gamma_{31} + \gamma_{32}} \right) +$$

$$+ \frac{\Omega_1 \Omega_2^* \rho_{32}}{i\delta + \gamma_{31} + \gamma_{32}}, \quad (П7)$$

$$0 = -i\Omega_2 n_{32} + \frac{\Omega_1^* \Omega_2 \rho_{21}}{i\delta + \gamma_{31} + \gamma_{32}} - \rho_{32} \left[\gamma_{21} + \gamma_{32} + \gamma_{31} + i(\delta - \Delta) + \frac{|\Omega_1|^2}{i\delta + \gamma_{31} + \gamma_{32}} \right].$$

Решая систему (П7), определяем стационарные значения $\bar{\rho}_{21}$ и $\bar{\rho}_{32}$ в следующем виде:

$$\bar{\rho}_{21} = -\frac{i\Omega_1 (|\Omega_1|^2 \bar{n}_{21} + |\Omega_2|^2 \bar{n}_{32} + D_2 \bar{n}_{21} \Gamma_{32})}{|\Omega_1|^2 D_1 + D_1 D_2 \Gamma_{32} + |\Omega_2|^2 \Gamma_{32}}, \quad (П8)$$

$$\bar{\rho}_{32} = -\frac{i\Omega_2 (|\Omega_1|^2 \bar{n}_{21} + D_1 D_2 \bar{n}_{32} + |\Omega_2|^2 \bar{n}_{32})}{|\Omega_1|^2 D_1 + D_1 D_2 \Gamma_{32} + |\Omega_2|^2 \Gamma_{32}}.$$

Подставив (П8) в систему (П4), можно найти стационарные решения для населенностей уровней:

$$\begin{aligned} \bar{\rho}_{11} &= 1 - \bar{\rho}_{22} - \bar{\rho}_{33}, \\ \bar{\rho}_{22} &= \frac{|\Omega_1|^2}{A} \{ |\Omega_2|^4 \Gamma_1 \gamma_{32} + |\Omega_2|^2 \{ \delta^2 [\Gamma_2^2 + (\Gamma_2 + \Gamma_3) \gamma_{21}] - 2\delta \Delta \Gamma_2 \gamma_{32} + \Gamma_2 (\Gamma_1^2 \Gamma_2 + \Delta^2 \gamma_{32} + \Gamma_1 \gamma_{21} \gamma_{32}) + (\Gamma_1 \Gamma_2 + \gamma_{21} \gamma_{32}) |\Omega_1|^2 \} + B \}, \end{aligned} \quad (П9)$$

$$\bar{\rho}_{33} = \frac{|\Omega_2|^2 |\Omega_1|^2}{A} \{ |\Omega_2|^2 \Gamma_1^2 + [(\delta - \Delta)^2 + \Gamma_1^2] \Gamma_2 \gamma_{21} + \Gamma_1 \gamma_{21} |\Omega_1|^2 \},$$

где

$$\begin{aligned} A &= |\Omega_2|^6 \Gamma_1 \Gamma_3 + B(\Delta^2 + \gamma_{21}^2 + 2|\Omega_1|^2) + |\Omega_2|^4 \{ [\delta^2 + \Delta^2 + \Gamma_1(\Gamma_1 + 2\Gamma_3)] \Gamma_2 \gamma_{21} - 2\delta \Delta (\Gamma_1 \Gamma_3 + \Gamma_2 \gamma_{21}) + [\gamma_{21}^2 + (\Gamma_1 + \Gamma_2)(\Gamma_1 - \gamma_{31})] |\Omega_1|^2 \} + |\Omega_2|^2 \{ \delta^2 [(2\Gamma_2^2 + \Gamma_1 \Gamma_3) \gamma_{21}^2 + \Delta^2 (\Gamma_1 \Gamma_3 + 4\Gamma_2 \gamma_{21}) + 2(\Gamma_1^2 + \gamma_{21} \gamma_{31}) |\Omega_1|^2] + 2\delta \Delta \Gamma_2 [-\gamma_{21}(\delta^2 + \Delta^2 + \Gamma_1^2 + 2\Gamma_2 \gamma_{21}) + (\gamma_{31} - \gamma_{32}) |\Omega_1|^2] + \Delta^2 \Gamma_2 (\Gamma_1 \Gamma_2 \Gamma_3 + 2\Gamma_2 \gamma_{21}^2 + \gamma_{32} |\Omega_1|^2) + (\Gamma_1 \Gamma_2 + |\Omega_1|^2) \Gamma_2 (2\Gamma_1 + \Gamma_3) \gamma_{21}^2 + (\Gamma_1^2 + \Gamma_2^2 + 2\gamma_{21} \gamma_{32}) |\Omega_1|^2 \}; \end{aligned}$$

$$B = \Gamma_2 \gamma_{21} \{ [(\delta - \Delta)^2 + \Gamma_1^2] (\delta^2 + \Gamma_2^2) + 2[\delta(\Delta - \delta) + \Gamma_1 \Gamma_2] |\Omega_1|^2 + |\Omega_1|^4 \};$$

$$\Gamma_1 = \gamma_{21} + \gamma_{31} + \gamma_{32}; \quad \Gamma_2 = \gamma_{31} + \gamma_{32}; \quad \Gamma_3 = \gamma_{21} + \gamma_{31}.$$

Таким образом, выражения (П8) и (П9) позволяют осуществить настройку необходимого режима взаимодействия КТ и сигнальной ППП путем управления пара-

метрами данного взаимодействия через интенсивность ППП накачки.

- Freitag M., Chizhova L.A., Nemes-Incze P., Woods C.R., Gorbachev R.V., Cao Y., Geim A.K., Novoselov K.S., Burgdörfer J., Libisch F., Morgenstern M. *Nano Lett.*, **16** (9), 5798 (2016).
- Tamagnone M., Slipchenko T.M., Moldovan C., Liu P.Q., Centeno A., Hasani H., Zurutuza A., Ionescu A.M., Martin-Moreno L., Faist J., Mosig J.R., Kuzmenko A.B., Poumirol J.-M. *Phys. Rev. B*, **97** (24), 241410(R) (2018).
- Liang X., Giacometti V., Ismach A., Harteneck B.D., Olynick D.L., Cabrini S. *Appl. Phys. Lett.*, **96** (1), 013109 (2010).
- Bozhevolnyi S.I., Martin-Moreno L., Garcia-Vidal F. *Quantum Plasmonics* (Cham: Springer International Publishing, 2017).
- Radko I.P., Volkov V.S., Beermann J., Evlyukhin A.B., Søndergaard T., Boltasseva A., Bozhevolnyi S.I. *Laser Photon. Rev.*, **3** (6), 575 (2009).
- Пшеничнюк И.А., Косолюбов С.С., Маймистов А.И., Драчев В.П. *Квантовая электроника*, **48** (12), 1153 (2018) [*Quantum Electron.*, **48** (12), 1153 (2018)].
- Pshenichnyuk I.A., Nazarikov G.I., Kosolobov S.S., Maimistov A.I., Drachev V.P. *Phys. Rev. B*, **100** (19), 195434 (2019).
- Dzedolik I.V., Skachkov S. *J. Opt. Soc. Am. A*, **36** (5), 775 (2019).
- Stebunov Y.V., Arsenin A.V., Volkov V.S., in *Chemically Derived Graphene: Functionalization, Properties and Applications* (Cambridge: The Royal Society of Chemistry Publishing, 2018, Ch. 12).
- Jiang Y., Lin X., Low T., Zhang B., Chen H. *Laser Photon. Rev.*, **12**, 1800049 (2018).
- Motlagh S., Apalkov V., Stockman M.I. arXiv: 1812.08812v1 (2018).
- Nesterov M.L., Bravo-Abad J., Nikitin A.Y., Garcia-Vidal F.J., Martin-Moreno L. *Laser Photon. Rev.*, **7** (2), 1 (2012).
- Kim B.-S., Neo D.C.J., Hou B., Park J., Cho Y., Zhang N., Hong J., Pak S., Lee S., Sohn J., Assender H.E., Watt A.A.R., Cha S., Kim J. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, **8** (22), 13902 (2016).
- Zhang Y., Cao M., Song X., Che Y., Ding X., Zhang G., Yao J., Dai H., Wang J. *J. Phys. Chem. C*, **119** (37), 21739 (2015).
- Cui G., Raymer M.G. *Phys. Rev. A*, **73** (5), 053807 (2006).
- Koppens F.H.L., Chang D.E., García de Abajo F.J. *Nano Lett.*, **11** (8), 3370 (2011).
- Fedorov A.V., Baranov A.V., Rukhlenko I.D., Perova T.S., Berwick K. *Phys. Rev. B*, **76** (4), 045332 (2007).
- Gubin M.Yu., Leksin A.Yu., Shesterikov A.V., Volkov V.S., Prokhorov A.V. *Appl. Surf. Sci.*, **506**, 144814 (2019).
- Chen W.-C. *Electrical Memory Materials and Devices* (Cambridge: The Royal Society of Chemistry Publishing, 2016).
- Sullivan D.M. *Electromagnetic Simulation Using the FDTD Method* (New York: Wiley-IEEE Press, 2000).
- Mock A. *Opt. Mater. Express*, **2**, 771 (2012).
- Aliofkhaezrai M., Ali N., Milne W.I., Ozkan C.S., Mitura S., Gervaso J.L. *Graphene Science Handbook. Electrical and Optical Properties* (Boca Raton: CRC Press, 2016).
- Lin X.S., Huang X.G. *Opt. Lett.*, **33** (23), 2874 (2008).
- Ryzhov I.V., Malikov R.F., Malyshev A.V., Malyshev V.A. *Phys. Rev. A*, **100** (3), 033820 (2019).
- Larkin I.A., Stockman M.I., Achermann M., Klimov V.I. *Phys. Rev. B*, **69** (12), 121403(R) (2004).
- Novotny L., Hecht B. *Principles of Nano-Optics* (New York: Cambridge University Press, 2006).
- Губин М.Ю., Гладуш М.Г., Прохоров А.В. *Оптика и спектроскопия*, **126** (1), 78 (2019) [*Opt. Spectrosc.*, **126** (1), 83 (2019)].
- De Wilde Y., Formanek F., Carminati R., Gralak B., Lemoine P.-A., Joulain K., Mulet J.-P., Chen Y., Greffet J.-J. *Nature*, **444**, 740 (2006).
- Gubin M.Yu., Leksin A.Yu., Shesterikov A.V., Prokhorov A.V., Volkov V.S. *Nanomaterials*, **10**, 122 (2020).
- Vakil A., Engheta N. *Science*, **332** (6035), 1291 (2011).
- Kim Y.S., Joo K., Jerng S.-K., Lee J.H., Yoon E., Chun S.-H. *Nanoscale*, **6** (17), 10100 (2014).
- Grigorenko A., Polini M., Novoselov K. *Nat. Photon.*, **6**, 749 (2012).
- Пивоваров П.А., Фролов В.Д., Заведеев Е.В., Конов В.И. *Квантовая электроника*, **47** (11), 1017 (2017) [*Quantum Electron.*, **47** (11), 1017 (2017)].
- Ratchford D., Shafiei F., Kim S., Gray S.K., Li X. *Nano Lett.*, **11** (3), 1049 (2011).
- Alles H., Aarik J., Kozlova J., Niilisk A., Rammula R., Sammelselg V., in *Graphene – Synthesis, Characterization, Properties and Applications* (Rijeka: InTech, 2011, Ch. 7).
- Jeon J.H., Jerng S.-K., Akbar K., Chun S.-H. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, **8** (43), 29637 (2016).
- Nayfeh O.M., Marr T., Dubey M. *IEEE Electron. Device Lett.*, **32** (4), 473 (2011).
- Kim S., Nah J., Jo I., Shahrjerdi D., Colombo L., Yao Z., Tutuc E., Banerjee S.K. *Appl. Phys. Lett.*, **94**, 062107 (2009).
- Hwang H.J., Cheng L., Lucero A.T., Lee B.H., Kim J. *Proc. 11th Int. Conf. IEEE NMD C* (Toulouse, France, 2016).
- Evlyukhin A.B., Reinhardt C., Evlyukhin E., Chichkov B.N. *J. Opt. Soc. Am. B*, **30** (10), 2589 (2013).
- Le Feber B., Rotenberg N., Kuipers L. *Nat. Commun.*, **6**, 6695 (2014).
- Terekhov P.D., Baryshnikova K.V., Shalin A.S., Karabchevsky A., Evlyukhin A.B. *Opt. Lett.*, **42** (4), 835 (2017).
- Sinev I.S., Komissarenko F.E., Mukhin I.S., Petrov M.I., Iorsh I.V., Belov P.A., Samusev A.K. *Nanosystems: Phys., Chem., Math.*, **9** (5), 609 (2018).
- Ho J., Tatebayashi J., Sergeant S., Fong C.F., Iwamoto S., Arakawa Y. *ACS Photonics*, **2** (1), 165 (2014).
- Noginov M.A., Zhu G., Belgrave A.M., Bakker R., Shalaev V.M., Narimanov E.E., Stout S., Herz E., Suteewong T., Wiesner U. *Nature*, **460** (7259), 1110 (2009).
- Линьков П., Самохвалов П., Вохминцев К., Звайгзне М., Кривенков В.А., Набиев И. *Письма в ЖЭТФ*, **109** (2), 108 (2019) [*JETP Lett.*, **109** (2), 112 (2019)].
- Gubin M.Yu., Shesterikov A.V., Karpov S.N., Prokhorov A.V. *Phys. Rev. B*, **97** (8), 085431 (2018).
- Шестериков А.В., Губин М.Ю., Карпов С.Н., Прохоров А.В. *Письма в ЖЭТФ*, **107** (7), 459 (2018) [*JETP Lett.*, **107** (7), 435 (2018)].
- Jian-Rong H., Jiu-Sheng L., Guo-Hua Q. *J. Infrared, Millimeter, Terahertz Waves*, **37** (7), 668 (2016).
- Bahadori-Haghighi S., Ghayour R., Sheikhi M.H. *Plasmonics*, **14** (2), 447 (2018).
- Jin Q., Li X., Chen J., Gao S. *Sci. Rep.*, **7** (1), 12290 (2017).
- Fedyanin D.Y., Yakubovsky D.I., Kirtaev R.V., Volkov V.S. *Nano Lett.*, **16** (1), 362 (2015).
- Ni G.X., McLeod A.S., Sun Z., Wang L., Xiong L., Post K.W., Sunku S.S., Jiang B.-Y., Hone J., Dean C.R., Fogler M.M., Basov D.N. *Nature*, **557** (7706), 530 (2018).
- Zhou J., Sun Q., Wang Q., Jena P. *Phys. Rev. B*, **92** (6), 064505 (2015).
- Ichinokura S., Sugawara K., Takayama A., Takahashi T., Hasegawa S. *ACS Nano*, **10** (2), 2761 (2016).
- Kong X.-T., Bai B., Dai Q. *Opt. Lett.*, **40** (1), 1 (2015).
- Britnell L., Ribeiro R.M., Eckmann A., Jalil R., Belle B.D., Mishchenko A., Kim Y.-J., Gorbachev R.V., Georgiou T., Morozov S.V., Grigorenko A.N., Geim A.K., Casiraghi C., Castro Neto A.H., Novoselov K.S. *Science*, **340** (6138), 1311 (2013).
- Palacios-Berraquero C., Barbone M., Kara D.M., Chen X., Goykhman I., Yoon D., Ott A.K., Beitner J., Watanabe K., Taniguchi T., Ferrari A.C., Atature M. *Nat. Commun.*, **7**, 12978 (2016).
- Yakubovsky D.I., Stebunov Y.V., Kirtaev R.V., Ermolaev G.A., Mironov M.S., Novikov S.M., Arsenin A.V., Volkov V.S. *Adv. Mater. Interfaces*, **6**, 1900196 (2019).